

集束イオンビーム装置講習会

平成29年度より、エレクトロニクス先端融合研究所（EIIRIS）の分析計測機器・半導体デバイス関連機器を対象とする共用システムがスタートしました。今回は、本学の特命技術職員が、集束イオンビーム装置の取扱い方法等に関する講習会を開催します。

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

要予約

日時

平成30年10月16日(火) 14:40 ~
10月17日(水) 14:40 ~

(内容同じ。参加者次第では1日開催)

場所

エレクトロニクス先端融合研究所 2階
共同研究室 5

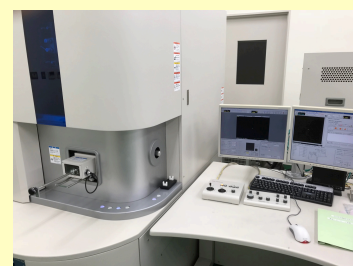
講師

溝端 秀聡 (特命技術職員)

機器

日立ハイテクノロジーズ
集束イオンビーム装置 (NB5000)
FIB加工, SIM・SEM観察など

- 測定原理 : イオン銃 : Gaイオン
電子銃 : Schottky放出型
- 分解能 : 5 nm (二次電子像, イオン加速電圧40 kV)
1.0 nm (二次電子像, 電子加速電圧15 kV)
- 加速電圧 : 1~ 40 kV (FIB)
0.5~30 kV (SEM)



集束イオンビーム装置
(日立 NB5000)

申込み EIIRIS共用システム (担当 : 溝端、渡邊)

内線 : 6979 e-mail : techsupport@rac.tut.ac.jp

WEBサイト : <http://rac.tut.ac.jp/sentan/>

このセミナーは、文部科学省「先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）」の一環として開催します。